

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2702798

### Способ изготовления высокоаспектных микроструктур

Патентообладатель: *Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения (ИЯФ СО РАН) (RU)*

Автор: *Лемзяков Алексей Георгиевич (RU)*

Заявка № 2018130185

Приоритет изобретения 20 августа 2018 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 11 октября 2019 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 20 августа 2038 г.

Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(52) СПК  
G03F 7/00 (2019.02)

(21)(22) Заявка: 2018130185, 20.08.2018

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
20.08.2018

Дата регистрации:  
11.10.2019

Приоритет(ы):  
(22) Дата подачи заявки: 20.08.2018

(45) Опубликовано: 11.10.2019 Бюл. № 29

Адрес для переписки:  
630090, г. Новосибирск, пр-кт Академика  
Лаврентьева, 11, ИЯФ СО РАН, ОНИО

(72) Автор(ы):  
Лемзяков Алексей Георгиевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):  
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение науки, Институт Ядерной  
Физики им. Г.И. Будкера Сибирского  
отделения (ИЯФ СО РАН) (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете  
о поиске: Y. Seki, Y. Furuta and etc.  
Electroplating using high-aspect-ratio  
microstructures fabricated by proton beam  
writing. Microelectronic Engineering 86 (2009)  
945-948. EP 2324975 B1, 21.12.2016. US 6673254  
B1, 06.01.2004. RU 2205469 C1, 27.05.2003.

(54) Способ изготовления высокоаспектных микроструктур

(57) Формула изобретения

Способ изготовления высокоаспектных микроструктур, заключающийся в радиационно-индуцированной абляции, отличающийся тем, что используется корпускулярное ионизирующее излучение.

RU 2 702 798 C1

КУ 2 702 798 C1